

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成20年10月30日(2008.10.30)

【公開番号】特開2007-113032(P2007-113032A)
 【公開日】平成19年5月10日(2007.5.10)
 【年通号数】公開・登録公報2007-017
 【出願番号】特願2005-303134(P2005-303134)
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/34 (2006.01)

C 2 2 C 5/04 (2006.01)

B 2 2 F 3/14 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/34 A

C 2 2 C 5/04

B 2 2 F 3/14 1 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

R u 粉末を通电焼結法により焼結した R u スパッタリング用ターゲットであって、金属組織が等軸晶からなり、かつスパッタ面が (0 0 2) 面配向であることを特徴とする R u スパッタリング用ターゲット材。

【請求項 2】

酸素含有量が 5 0 質量 p p m 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の R u スパッタリング用ターゲット材。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

すなわち、本発明は、R u 粉末を通电焼結法により焼結した R u スパッタリング用ターゲットであって、金属組織が等軸晶からなり、かつスパッタ面が (0 0 2) 面配向である R u スパッタリング用ターゲット材である。

好ましくは、酸素含有量が 5 0 質量 p p m 以下であり、スパッタ面が (0 0 2) 面配向である R u スパッタリング用ターゲット材である。